

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第2区分
 【発行日】平成19年11月29日(2007.11.29)

【公表番号】特表2007-513158(P2007-513158A)
 【公表日】平成19年5月24日(2007.5.24)
 【年通号数】公開・登録公報2007-019
 【出願番号】特願2006-542640(P2006-542640)
 【国際特許分類】

C 0 7 F 15/00 (2006.01)

【F I】

C 0 7 F 15/00 E
 C 0 7 F 15/00 F

【手続補正書】

【提出日】平成19年10月15日(2007.10.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

所望の有機配位子の有機亜鉛錯体と、離脱基を担持する原子番号74~79の元素の金属錯体とを、非プロトン性有機溶剤中で反応させる工程を含む、有機金属シクロメタル化錯体を形成する方法。

【請求項2】

原子番号74~79の該元素が白金である、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

該配位子が、 sp^2 炭素及びヘテロ原子を介して金属に配位結合することができるモノアニオン性配位子である、請求項1又は2に記載の方法。

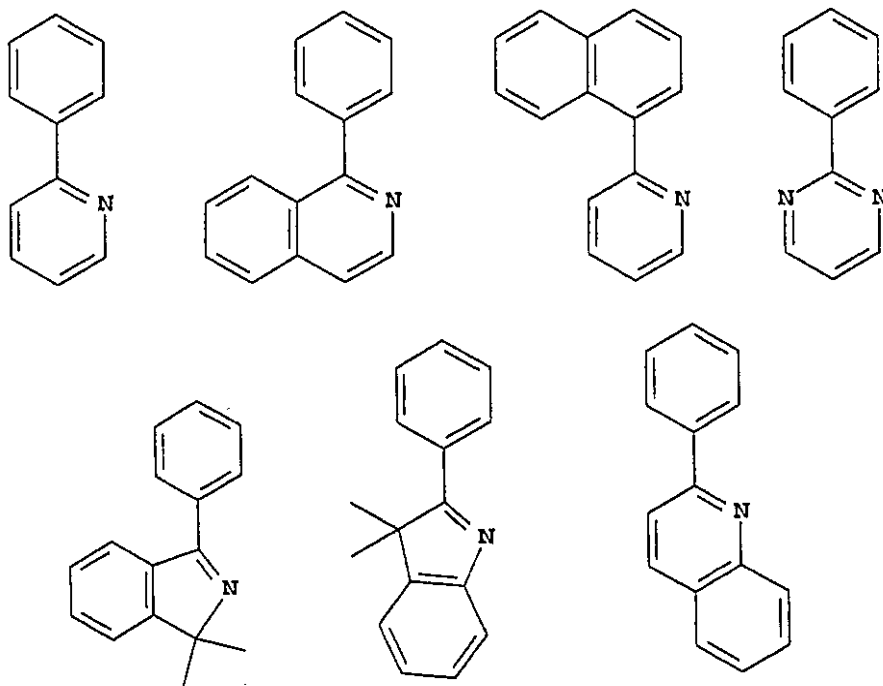
【請求項4】

該配位子が、芳香環及び複素環を含む、請求項3に記載の方法。

【請求項5】

該配位子が、下記のもの：

【化1】



の中から選ばれた1つ以上を含む、請求項4に記載の方法。

【請求項6】

該溶剤が、エーテル、ハロゲン化アルキル、極性非プロトン性溶剤、又はニトリル基を含む、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。

【請求項7】

該溶剤が、実質的に水を含有しない、請求項1~6のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】

該離脱基が、ピリジン、ジエチルスルフィド、ジエチルエーテル、ジメチルスルホキシド、又はテトラヒドロフランを含む、請求項1~7のいずれか一項に記載の方法。

【請求項9】

該離脱基のうちの1つ又は2つ以上が-1電荷を有する、請求項8に記載の方法。

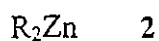
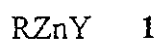
【請求項10】

該離脱基が、塩化物、臭化物、ヨウ化物、フッ化物、アセテート、アセトニルアセテート、トリフルオロメタンスルホネート、又はメトキシドを含む、請求項9に記載の方法。

【請求項11】

該有機亜鉛錯体が、式1又は2によって表される請求項1~10のいずれか一項に記載の方法：

【化2】



(上記式中、Yはアニオンであり、そしてRは、炭素及びヘテロ原子を介して金属に配位結合することができるモノアニオン性配位子である)。